PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-021245

(43) Date of publication of application: 21.01.2000

(51)[nt,Cl.

H01B 3/46 C08L 83/04 C08L101/00

(21)Application number: 10-187704

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing:

02.07.1998

(72)Inventor: HIRAHARU AKIO

MATSUI TAKASHI

(54) LOW DIELECTRIC MOLDING MATERIAL AND LOW DIELECTRIC

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To surely form a dielectric with a low dielectric constant between conductors of an integrated circuit and between semiconductor elements with ease by comprising a matrix formable cureable precursor and hollow polymer particles.

SOLUTION: One of resin suitable for a setting precursor is a thermosetting resin such as an epoxy resin and polyimide resin, while the other is a substance containing one or more kind of substance selected from organosilane represented by a general formula R1nSi(OR2)4-n, its hydrolyte, and its partial condensate as a principal constituent. In the formula, R1 is a 1-8C organic group, R2 is an 6-20C alkyl group, 1-6C acyl group or 6-20C aryl group; and (n) is 0-2. As this kind of organosilane, tetramethoxysilane and the like are available. A mean grain size of the hollow polymer grain is desirably 0.03-10 μm.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-21245

(P2000-21245A)

(43)公開日 平成12年1月21日(2000.1.21)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01B 3/46 C08L 83/04

101/00

H01B 3/46 C08L 83/04 B 4J002

5 G 3 O 5

101/00

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平10-187704

(71)出顧人 000004178

ジェイエスアール株式会社

(22)出願日 平成10年7月2日(1998.7.2) 東京都中央区築地2丁目11番24号

(72)発明者 平春 晃男

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 松井 尚

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 低誘電体形成材料および低誘電体

(57)【要約】

【課題】 所望の低誘電率の誘電体を集積回路の導体間 および半導体素子間に確実かつ容易に形成することがで き、集積回路を消費電力を増大させずにより小さなパッ ケージに収納することを可能とする材料およびこの材料 から形成される低誘電体を提供すること。

【解決手段】 マトリックスを形成し得る硬化性前駆体 と、中空ポリマー微粒子を含有する低誘電体形成材料お よびこの材料から形成される低誘電体が提供される。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マトリックスを形成し得る硬化性前駆体 と、中空ポリマー微粒子を含有することを特徴とする低 誘電体形成材料。

【請求項2】 マトリックスを形成し得る硬化性前駆体 が、下記一般式(1)で示されるオルガノシラン、該オ ルガノシランの加水分解物、および該オルガノシランの 部分縮合物からなる群から選択される少なくとも1種を 主成分として含有することを特徴とする請求項1に記載 の低誘電体形成材料。

 $R^1_n S i (OR^2)_{4-n}$ 一般式(1)

(上記一般式(1)において、R1は炭素数1~8の1価 の有機基であり、R'は炭素数1~5のアルキル基、炭 素数1~6のアシル基、または炭素数6~20のアリー ル基であり、nは0~2の数である)

【請求項3】 中空ポリマー微粒子の平均粒径が0.0 $3 \sim 1.0 \mu \text{ m}$ であることを特徴とする請求項1または3に記載の低誘電体形成材料。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の低誘電 体形成材料を硬化させて得られる低誘電体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、集積回路の導体 間、半導体素子間等に設けられる低誘電体を形成するの に好適な材料、および該材料から形成される低誘電体に 関する。

[0002]

【従来の技術】コンピュータ、テレビジョン等の電子装 置の集積回路に、半導体は広く用いられている。これら の集積回路は、通常、複雑な機能を実行するために、さ 30 形成材料を硬化させて得られる低誘電体。 らにはデータを記憶するために、単結晶シリコン・チッ プの上に複数個のトランジスタが形成されている。これ らの集積回路は、より小型のバッケージに収納すること ができ、しかも消費電力の少ないことが要求されてい る。しかしながら、これらの要求は両立させることが難 しく、十分に満たされていない。

【0003】例えば、小型のパッケージに収納すべく、 回路の寸法を $0.5\mu m$ から $0.25\mu m$ に小さくした 場合、消費電力は約30%上昇する。また、小型のバッ ケージに収納することにより、チップに信号を送受する 40 ための複数の導電体間の静電容量が増加して信号が相互 に混入する現象が起こるため、最高通信速度が遅くなる と共にS/N比が低下する。

【0004】これらの問題を解決すべく上記導電体間に 存在する誘電体の誘電率を小さくすることが従来より行 われているが、未だ不十分であり、誘電体のさらなる低 誘電率化が求められ、しかも低誘電率の誘電体を確実か つ容易に得られる材料の出現が求められている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、低誘 50 よび効果が明らかになるであろう。

電率の誘電体を、集積回路の導体間および半導体素子間 に確実かつ容易に形成し得る材料を提供することにあ る。本発明の他の目的は、集積回路を消費電力を増大さ せずにより小さなパッケージに収納することを可能とす る低誘電体を形成し得る材料を提供することにある。本 発明のさらなる他の目的は、上記材料から形成される低 誘電体を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、下記の 低誘電体形成材料、および低誘電体が提供されて、本発 10 明者の上記目的が達成される。

[1]マトリックスを形成し得る硬化性前駆体と、中空 ポリマー微粒子を含有することを特徴とする低誘電体形 成材料。

[2]マトリックスを形成し得る硬化性前駆体が、下記 一般式(1)で示されるオルガノシラン、該オルガノシ ランの加水分解物、および該オルガノシランの部分縮合 物からなる群から選択される少なくとも1種を主成分と して含有することを特徴とする上記〔1〕に記載の低誘 20 電体形成材料。

 $R^{1}_{n} S i (OR^{2})_{4-n}$ 一般式(1)

(上記一般式(1)において、R1は炭素数1~8の1価 の有機基であり、R'は炭素数1~5のアルキル基、炭 素数1~6のアシル基、または炭素数6~20のアリー ル基であり、nは0~2の数である)

[3]中空ポリマー微粒子の平均粒径が0.03~10 μmであることを特徴とする上記〔1〕または〔2〕に 記載の低誘電体形成材料。

〔4〕上記〔1〕~〔3〕のいずれかに記載の低誘電体

【0007】本発明の低誘電体形成材料は、熱硬化性樹 脂やオルガノシラン、オルガノシランの加水分解物、オ ルガノシランの部分縮合物、あるいはこれらの混合物等 の硬化性前駆体と、予め製造された中空ポリマー微粒子 とが均一に分散した塗布液として調製することができ る。そして中空ポリマー微粒子は、誘電率が小さい空気 あるいは窒素等の気体を含んでいるので、中空ポリマー 微粒子を含有する上記の塗布液を、例えば集積回路の導 電体間に塗布、硬化することからなる容易な操作によ り、マトリックス中に中空ポリマー微粒子が均一に分散 した低誘電率の誘電体を導電体間に形成することができ る。しかも、後記する方法により、中空ポリマー微粒子 を均一な粒径および空隙率を有する中空微粒子として調 製することができる。従って、本発明の低誘電体形成材 料から、低誘電率の誘電体を確実に歩留まりよく形成す ることができる。その結果、例えばコンピューターに用 いられるROM、RAM等の電子部品を消費電力を上昇 させずに小型化させることが可能となる。以下、本発明 を詳述するが、それにより本発明の他の目的、利点、お

3

[8000]

【発明の実施の形態】本発明の低誘電体形成材料は、硬 化してマトリックスを形成し得る硬化性前駆体と中空ポ リマー微粒子を含有する。まず、硬化性前駆体について 説明する。硬化性前駆体は、硬化してマトリックスを形 成し得るものであれば、特に制限されないが、好ましい 硬化性前駆体として下記の(イ)および(ロ)を挙げる ことができる。

(イ) 熱硬化性樹脂からなる硬化性前駆体。

(ロ)上記一般式(1)で示されるオルガノシシラン、 オルガノシランの加水分解物、およびオルガノシランの 部分縮合物からなる群から選択される少なくとも1種を 主成分として含有する硬化性前駆体。

【0009】上記(イ)硬化性前駆体の熱硬化性樹脂と しては、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、シアネート 樹脂、シアン酸エステル樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポ リエステル樹脂等を挙げることができるが、これらに限 定されない。なかでも、特に好ましい熱硬化性樹脂は、 エボキシ樹脂およびポリイミド樹脂である。

【0010】上記(ロ)の一般式(1)で示されるオル 20 ガノシラン(以下、「オルガノシラン(1)」ともいう) において、R1は炭素数1~8の有機基であり、R1は炭 素数1~5のアルキル基、炭素数1~6のアシル基、ま たは炭素数6~20のアリール基であり、nは0~2の 数である。一般式(1)において、R1の 1価の有機基 としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル 基、iープロビル基、nーブチル基、iーブチル基、s ec-ブチル基、t-ブチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基等 のアルキル基や、ビニル基、アリル基、シクロヘキシル 30 基、フェニル基、アシル基、グリシジル基、(メタ)ア クリルオキシ基、ウレイド基、アミド基、フルオロアセ トアミド基、イソシアナート基等のほか、これらの基の 置換誘導体等を挙げることができる。上記置換誘導体の 置換基としては、例えばハロゲン原子、置換もしくは非 置換のアミノ基、水酸基、メルカプト基、イソシアナー ト基、グリシドキシ基、3、4-エポキシシクロヘキシ ル基、(メタ)アクリルオキシ基、ウレイド基、アンモ ニウム塩基等を挙げることができる。ここで、R1が置 換誘導体である場合、R¹の炭素数は置換基中の炭素原 40 子を含めた炭素数である。一般式(1)中にR¹が複数 存在する場合、相互に同一でも異なってもよい。

【0011】また、R'のアルキル基としては、例えば メチル基、エチル基、n-プロビル基、i-プロピル 基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、 n-ペンチル基等を挙げることができ、炭素数1~6の アシル基としては、例えばアセチル基、プロピオニル 基、ブチリル基、バレリル基、カプロイル基等を挙げる ことができ、炭素数6~10のアリール基としては、フ

数存在するR² は、相互に同一でも異なってもよい。

【0012】このようなオルガノシラン(1)の具体例 としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーi-プロ ポキシシラン、テトラーn-ブトキシシラン等のテトラ アルコキシシラン類;メチルトリメトキシシラン、メチ ルトリエトキシシラン、メチルトリフェノキシシラン、 メトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、エチルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキ シシラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-プ ロピルトリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキシ シラン、i-プロピルトリフェノキシシラン、n-ブチ ルトリメトキシシラン、n-ブチルトリエトキシシラ ン、n-ブチルトリフェノキシシラン、n-ペンチルト リメトキシシラン、n-ヘキシルトリメトキシシラン、 n-ヘプチルトリメトキシシラン、n-オクチルトリメ トキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリ エトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシシラン、 シクロヘキシルトリエトキシシラン、フェニルトリメト キシシラン、フェニルトリエトキシシラン、3-クロロ プロピルトリメトキシシラン、3-クロロプロピルトリ エトキシシラン、3,3,3-トリフロロプロピルトリ メトキシシラン、3,3,3-トリフロロプロピルトリ エトキシシラン、3-アミノプロビルトリメトキシシラ ン、3-アミノプロピルトリエトキシシラン、2-ヒド ロキシエチルトリメトキシシラン、2-ヒドロキシエチ ルトリエトキシシラン、2-ヒドロキシプロピルトリメ トキシシラン、2-ヒドロキシプロピルトリエトキシシ ラン、3-ヒドロキシプロピルトリメトキシシラン、3 -ヒドロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メルカ プトプロピルトリメトキシシラン、3-メルカプトプロ ビルトリエトキシシラン、3-イソシアナートプロビル トリメトキシシラン、3-イソシアナートプロピルトリ エトキシシラン、3-グリシドキシプロピルトリメトキ シシラン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラ ン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルト リメトキシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキ シル) エチルトリエトキシシラン、3-(メタ) アクリ ルオキシプロピルトリメトキシシラン、3-(メタ)ア タクリルオキシプロピルトリエトキシシラン、3-ウレ イドプロピルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピ ルトリエトキシシラン等のトリアルコキシシラン類;ジ メチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、 ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシシラ ン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルジフェノキシ シラン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnー プロピルジエトキシシラン、ジーi-プロピルジメトキ シシラン、ジー i - プロピルジエトキシシラン、ジー n ェニル基等を挙げることができる。一般式(1)中に複 50 - ブチルジメトキシシラン、ジョn - ブチルジエトキシ

シラン、ジーnーペンチルジメトキシシラン、ジーnーペンチルジエトキシシラン、ジーnーヘキシルジエトキシシラン、ジーnーヘブチルジメトキシシラン、ジーnーヘブチルジエトキシシラン、ジーnーオクチルジエトキシシラン、ジーnーオクチルジエトキシシラン、ジーnーシクロヘキシルジメトキシシラン、ジーnーシクロヘキシルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルエトキシシラン、カリメチルエトキシシラン、カリメチルエトキシシラン、カリメチルアセチルオキシシラン等を挙げることができる。

【0014】本発明の(ロ)硬化性前駆体は、上記オルガノシラン(1)そのまま、その加水分解物、その部分縮合物、あるいはこれらの任意の組み合わせを主成分として含有する。(ロ)硬化性前駆体が、オルガノシラン(1)の加水分解物および/または部分縮合物を含有する場合、予めオルガノシラン(1)を加水分解、部分縮合させて使用することもできるが、後述するように、オルガノシラン(1)を残りの成分と混合して低誘電体形成材料を調製する際に、適量の水を添加することにより、オルガノシラン(1)を加水分解、部分縮合させて、使用することが好ましい。硬化性前駆体が上記部分縮合物を主成分とするとき、該部分縮合物のポリスチレン換算重量平均分子量(以下、「Mw」という)は、好ましくは800~100、000、さらに好ましくは1、000~50、000である。

【0015】また、オルガノシラン(1)は市販されており、本発明の(ロ)硬化性前駆体として用いることができる。市販品としては、三菱化学(株)製のMKCシリケート、多摩化学(株)製のシリケート、東レ・ダウコーニング社製のシリコンレジン、日本ユニカ(株)製のシリコンオリゴマー等があり、これらをそのまま、または縮合させて使用してもよい。

*【0016】さらに、本発明の低誘電体形成材料では、 上記オルガノシラン(1)に対して、下記の(A)~ (C)成分を添加することができる。

【0017】〔(A)成分〕(A)成分は、水および/ または有機溶媒からなる。通常、低誘電体形成材料を調 製する際に、オルガノシラン(1)を加水分解し、引き 続く部分縮合反応を生じさせ、あるいは中空ポリマー粒 子を分散させるために、水が添加される。水の使用量 は、オルガノシラン(1)1モルに対して、通常0.5 ~3 モル、好ましくは 0. 7~2 モル程度である。ま た、上記有機溶剤としては、主として低誘電体形成材料 中の各成分等を均一に混合させ、低誘電体形成材料の全 固形分濃度を調整すると同時に、低誘電体形成材料の分 散安定性および保存安定性をさらに向上させるために使 用される。このような有機溶剤としては、前記各成分を 均一に混合できるものであれば特に限定されないが、例 えばアルコール類、芳香族炭化水素類、エーテル類、ケ トン類、エステル類等の1種以上を挙げることができ る。これらの有機溶剤は、1種単独であるいは2種以上

【0018】〔(B)成分〕(B)成分は、オルガノシラン(1)成分等の加水分解、縮合反応を促進する触媒である。本発明においては、(B)成分を用いることにより、得られる低誘電体形成材料の硬化速度を高めるとともに、使用されるオルガノシラン成分の重縮合反応により生成されるボリシロキサン樹脂の分子量が大となり、強度、長期耐久性等に優れた低誘電体を得ることができ、かつ厚みの大きい低誘電体が形成容易となると共に形成作業そのものも容易となる。このような(B)成分として、酸性化合物、アルカリ性化合物、塩化合物、アミン化合物、有機金属化合物および/またはその部分加水分解物(以下、有機金属化合物および/またはその部分加水分解物をまとめて「有機金属化合物等」という)が好ましい。

【0019】(B)成分のうち、酸性化合物としては、例えば酢酸等が挙げられる。またアルカリ性化合物としては、例えばアンモニア、アミン、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、が挙げられる。また塩化合物としては、例えばアルカリ金属塩等が挙げられる。またアミン(クロック)のでは、例えば3ーアミノブロビル・トリエトキシシラン、3ーアミノブロビル・トリエトキシシラン、3ー(2ーアミノブロビル・トリエトキシシラン、3ー(2ーアミノエチル)ーアミノブロビル・トリエトキシシランが挙げられる。また有機金属化合物としては、例えば下記一般式(2)で表される化合物(以下、「有機金属化合物(2)という。)、同一の錫原子に結合した炭素数1~10のアルキル基を1~2個有する4価錫の有機金属化合物(以下、「有機錫化合物」という。)

M(OR¹⁰)p(R¹¹COCHCOR¹²)q 一般式(2)

(式中、Mはジルコニウム、チタンまたはアルミニウム 50 を示し、R10 およびR11は、それぞれ独立に、エチル

基、nープロビル基、iープロビル基、nープチル基、secーブチル基、tープチル基、nーペンチル基、nーペキシル基、シクロヘキシル基、フェニル基等の炭素数1~6の1価の炭化水素基を示し、R¹¹は、R¹⁰およびR¹¹と同様の炭素数1~6の1価の炭化水素基のほか、メトキシ基、エトキシ基、nープロボキシ基、iープロボキシ基、nープトキシ基、secーブトキシ基、tーブトキシ基、ラウリルオキシ基、ステアリルオキシ基等の炭素数1~16のアルコキシル基を示し、pおよびqは0~4の整数であり、pとqの合計はMの原子価 10である。)

【0020】上記有機金属化合物(2)の具体例として は、有機ジルコニウム化合物;チタン化合物;アルミニ ウム化合物等を挙げることができる。これらの有機金属 化合物(2)およびその部分加水分解物のうち、トリー n-ブキトシ・エチルアセトアセテートジルコニウム、 ジー i - プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チ タニウム、ジー i - ブロポキシ・エチルアセトアセテー トアルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム、あるいは、これらの化合物の部分加水分 20 解物が好ましい。また、有機錫化合物の具体例として は、カルボン酸型有機錫化合物;メルカプチド型有機錫 化合物;スルフィド型有機錫化合物;クロライド型有機 錫化合物等を挙げることができる。(B)成分は、単独 でまたは2種以上を組み合わせて使用することができ、 また亜鉛化合物やその他の反応遅延剤と併用することも できる。

【0021】(B)成分の使用量は、有機金属化合物等以外の場合、前記オルガノシラン(1)100重量部に対して、通常0~100重量部、好ましくは0.01~3080重量部、さらに好ましくは0.1~50重量部である。有機金属化合物等の場合、オルガノシラン(1)100重量部に対して、通常0~100重量部、好ましくは0.1~80重量部、さらに好ましくは0.5~50重量部である。この場合、(B)成分の使用量が100重量部を超えると、低誘電体形成材料の保存安定性が低下したり、硬化された低誘電体にクラックが発生しやすくなる傾向がある。

【0022】〔(C)成分〕(C)成分は、下記一般式(3)

R¹¹COCH₂COR¹² 一般式(3)

(式中、R¹¹およびR¹²は、有機金属化合物(2)における前記各一般式のそれぞれR¹¹およびR¹²と同義である)で表されるβージケトン類および/またはβーケトエスケル類、カルボン酸化合物、ジヒドロキシ化合物、アミン化合物およびオキシアルデヒド化合物の群から選ばれる少なくとも1種からなる。このような(C)成分は、特に、前記(B)成分として有機金属化合物等を使用する場合に併用することが好ましい。(C)成分は、低誘電体形成材料の安定性向上剤として作用するもので 50

ある。即ち、(C)成分が前記有機金属化合物等の金属原子に配位することにより、該有機金属化合物等による前記オルガノシラン(1)成分の共縮合反応を促進する作用を適度にコントロールし、得られる低誘電体形成材料の保存安定性をさらに向上させる作用をなすものと考えられる。

【0023】(C)成分の具体例としては、アセチルアセトン、アセト酢酸エチル等が挙げられる。(C)成分は、1種単独でまたは2種以上を組み合わせて使用することができる。(C)成分の使用量は、前記有機金属化合物等における有機金属化合物1モルに対して、通常2モル以上、好ましくは3~20モルである。この場合、

(C) 成分の使用量が2モル未満では、得られる低誘電体形成材料の保存安定性の向上効果が不十分となる傾向がある。

【0024】次に本発明の低誘電体形成材料に含有される中空ポリマー微粒子について説明する。上記中空ポリマー微粒子の平均粒子径は、好ましくは $0.03\sim10$ μ m、さらに好ましくは $0.05\sim3$ μ m、就中 $0.1\sim0.5$ μ mである。中空ポリマー微粒子の内径は、好ましくは外径の $0.1\sim0.9$ 倍、さらに好ましくは $0.2\sim0.9$ 倍、特に好ましくは $0.3\sim0.9$ 倍である。また、中空ポリマー微粒子の平均比重は、好ましくは $0.5\sim1.2$ 、さらに好ましくは $0.6\sim1.1$ である。中空ポリマー微粒子の平均粒子径、内径と外径との比、および平均比重が上記範囲にあると、得られる本発明の低誘電体形成材料から形成される誘電体が低誘電率となる。

【0025】 このような中空ポリマー微粒子は、架橋または非架橋であり、下記(I)~(IX)の種々の方法で製造することができる(特公平4-68324号公報等参照)。

- (I) 架橋ポリマー粒子中に発泡剤を含有させ、後にこの発泡剤を発泡させる方法。
- (II)架橋ボリマーにブタン等の揮発性物質を封入し、 後にこの揮発性物質をガス化する方法。
- (III)架橋ポリマーを溶融し、これに空気等の気体ジェットを吹き込み、気泡を封入する方法。
- (IV) 架橋ポリマー粒子あるいは非架橋粒子の内部にア 40 ルカリ膨潤性の物質を浸透させて、アルカリ膨潤性の物質を膨潤させる方法。
 - (V) 水中油型のモノマーエマルジョンを調製し、重合 を行う方法。
 - (VI) 不飽和ポリエステル溶液中に顔料を懸濁させ、該溶液中でモノマーを重合する方法。

(VII) 架橋性ポリマー粒子をシードとして、該架橋性ポリマーと相溶性の無いポリマーをそのシード上に重合、架橋する二段架橋方法。

(VIII) ポリマーの重合収縮により製造する方法。

(IX) 架橋性ポリマー粒子を噴霧乾燥させる方法。

【0026】上記方法のなかで、上記(VII)の方法が好 ましい。方法(VII)を行うに当たって、下記の態様で行 うことが極めて好ましい。即ち、(a)架橋性モノマー 1~50重量%、(b)不飽和カルボン酸1~40重量 %および/またはその他の親水性モノマー5~99重量 %からなる親水性モノマー(以下、「(b)親水性モノ マー)」という) 1~99重量%、ならびに(c)共重 合可能なその他の重合性モノマー(以下、「(c)他の 重合性モノマー」という)0~85重量%よりなる重合 性モノマー成分100重量部を、該重合性モノマー成分 10 が同じであっても分子量が異なる場合、共重合モノマー の重合ポリマーとは異なるポリマー(以下、「異種ポリ マー」という)シードポリマー)1~100重量部の存 在下において水中に分散し、次いで前記重合性モノマー 成分を重合させる方法である(特開昭62-12733 6号公報参照)。

9

【0027】なお、上記態様で得られた(架橋)中空ポリ マー微粒子をシードポリマーとして、上記(a)架橋性モ ノマー、(b)親水性モノマーおよび(c)他の重合性 モノマーから選ばれた少なくとも1種をシード重合する ことにより、本発明で用いることができる(架橋)中空ボ 20 リマー微粒子を製造することもできる(特開平2-14 0271号公報および同2-140272号公報参

【0028】前記(a)架橋性モノマーとしては、ジビ ニルベンゼン、エチレングリコールジメタクリレート、 1,3-ブチレングリコールジメタクリレート、トリメ チロールプロパントリメタクリレート、アリルメタクリ レート等のジビニル系モノマー、あるいはトリビニル系 モノマーを例示することができ、特に、ジビニルベンゼ ン、エチレングリコールジメタクリレートおよびトリメ 30 チロールプロパントリメタクリレートが好ましい。前記 (b) 親水性モノマーとしては、ビニルピリジン、グリ シジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、メチ ルアクリレート、メチルメタクリレート、アクリロニト リル、アクリルアミド、N-メチロールアクリルアミ ド、N-メチロールメタクリルアミド、アクリル酸、メ タクリル酸、イタコン酸、フマル酸、スチレンスルホン 酸ナトリウム、酢酸ビニル、ジメチルアミノエチルメタ クリレート、ジエチルアミノエチルメタクリレート、2 -ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシプ 40 ロピルメタクリレート等のビニル系モノマーを例示する ことができる。このうちメタクリル酸、イタコン酸、ア クリル酸が好ましい。前記(c)他の重合性モノマーと しては、ラジカル重合性を有するものであれば特に制限 されず、スチレン、α-メチルスチレン、p-メチルス チレン、ハロゲン化スチレン等の芳香族ビニル単量体; プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類;エチルメタ クリレート、ブチルアクリレート、ブチルメタクリレー ト、2-エチルヘキシルアクリレート、2-エチルヘキ シルメタクリレート、ラウリルアクリレート、ラウリル 50 チップ間を電気信号を送受するための導電体間に低誘電

メタクリレート等のエチレン性不飽和カルボン酸アルキ ルエステル;フェニルマレイミド、シクロヘキシルマレ イミド等のマレイミド化合物;ブタジエン、イソプレン 等の共役ジオレフィン等を例示することができ、特にス チレンが好ましい。

【0029】上記異種ポリマーは、少なくとも上記重合 性モノマー(a)~(c)を重合して得られるポリマー とは、異なるポリマーである。ととで、「異なる」と は、重合モノマーの種類が異なる場合、共重合モノマー が同じであっても共重合割合が異なる場合等を含む広い 概念である。

【0030】このような異種ボリマーとしては、具体的 にはポリスチレン、カルボキシ変性ポリスチレン、カル ボキシ変性スチレンーブタジエンコポリマー、スチレン - ブタジエンコポリマー、スチレン- アクリルエステル コポリマー、スチレンーメタクリルエステルコポリマ ー、スチレン-アクリルエステルコポリマー、メタクリ ルエステルコポリマー、カルボキシ変性(スチレン-ア クリルエステル) コポリマー、カルボキシ変性(スチレ ンーメタクリルエステル)コポリマー等が例示される。 特に好ましい異種ポリマーは、ポリスチレンおよびスチ レン成分を50重量%以上含むスチレンコポリマーであ る。

【0031】中空ポリマー微粒子は、架橋していること が好ましい。そして架橋の程度は、加熱、加圧して、絶 縁板を成形する際に、架橋中空ポリマー微粒子が粒子の 形態を保つ程度に架橋していることが好ましい。

【0032】このような方法により、特に上記で詳述し た(VII)の方法により、平均粒径の-20%~+20% の範囲内の粒径の粒子が70重量%以上を占める粒子径 の均一な微粒子が得られる。この微粒子を用いると本発 明の目的が1段と優れて達成され、好ましい。

【0033】本発明の低誘電体形成材料において、中空 ポリマー微粒子の硬化性前駆体への配合は、本発明の低 誘電体の誘電率をいかなる値にするか、使用する硬化性 前駆体の種類、中空ポリマー微粒子の種類あるいは添加 量、その他の要因を考慮して、適宜決定することができ るが、通常ワニス状の低誘電体形成材料の硬化性前駆体 (固形分換算)100重量部に対して、好ましくは1~2 00重量部、より好ましくは5~150重量部、さらに 好ましくは10~100重量部となるような量割合で配

【0034】中空ポリマー微粒子は、水分散体状もしく はアルコール等の有機溶媒の分散状あるいは乾燥粉体状 で配合してもよいが、乾燥粉体状の中空ポリマー微粒子 を硬化性前駆体のワニスに配合することが好ましい。

【0035】本発明の低誘電体は、低誘電体形成材料を 硬化させることにより形成される。例えば、集積回路の

体を形成する場合、あるいは回路が形成された基板を積 層し、基板間に絶縁層を兼ねた低誘電体層を形成する場 合、ワニス状の低誘電体形成材料を所定の部分に塗布 し、硬化させることにより低誘電体(層)が形成される。 【0036】低誘電体形成材料に含有される硬化性前駆 体が(イ)熱硬化性樹脂の場合、低誘電体形成材料ワニ スは、該樹脂の硬化前前駆体を溶媒に溶解してワニスと なし、そこに中空ポリマー微粒子を分散させることによ り調製することができる。塗布後の硬化は、乾燥後、熱 硬化性樹脂の種類に応じた温度に加熱することにより行 10 われる。ワニス化するために用いることができる溶媒 は、熱硬化性樹脂の種類により適宜選択され、例えばエ ポキシ樹脂の場合、エチルカルビトール等が好適に使用 される。

【0037】低誘電体形成材料に含有される硬化性前駆 体が(ロ)オルガノシラン(1)、その加水分解物、そ の部分縮合物、あるいはこれらの混合物の場合、これら は液状であるので、中空微粒子を添加し、分散させ、そ れを硬化して低誘電体(層)が形成される。

【0038】本発明の低誘電体形成材料は、本発明の目 20 的の達成を損なわない範囲で、耐熱性を持たせるために 用いられるハロゲン含有有機物、酸化アンチモン等の難 燃剤、その他の無機系あるいは有機系の充填剤等を配合 することができる。

【0039】また本発明の低誘電体形成材料から、特に 硬化性前駆体が(ロ)前記式(1)で示されるオルガノ シラン、その加水分解物、その部分縮合物、あるいはと れらの混合物の場合に、下記の多孔質物質を好適に形成 することができる。

(i)米国特許第5,638,599号に記載されている 30 赤外線(熱線)検知器の赤外線検知回路上に使用される低 誘電率材料のための多孔質物質。

(ii) 米国特許第5,689,151号に記載されている フィールドエミッション型デイスプレイの陰極プレート の基板上に使用される低誘電率材料のための多孔質物 質。

(iii) ブラズマデイスプレイの前面誘電体。 [0040]

【実施例】以下、実施例により、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも 40 のではない。なお、実施例中の%および部は、特に断ら ない限り、重量基準である。また、実施例および比較例 の各種測定は、下記の方法により行った。

(1)誘電率および誘電正接: JIS-C-6481に 準拠して測定した。

(2)柔軟性:実施例、比較例で作成したテストピース を手で曲げ、その感触で下記の4段階評価を行った。

◎:柔軟性に優れる

〇:柔軟性にやや優れる

△:柔軟性にやや劣る

×:柔軟性に劣る

【0041】<中空ポリマー微粒子の製造例>スチレン 70部、ブタジエン27部、イタコン酸3部およびt-ドデシルメルカプタン12部に、水200部にラウリル 硫酸ナトリウム 0. 5 部および過硫酸カリウム 1. 0 部 を溶かした水溶液を攪拌しながら、70℃で8時間重合 してポリマー粒子を得た。このポリマー粒子の平均粒子 径は0.24μm、トルエン不溶解分は6%、GPCに よる数平均分子量は5,000、重量平均分子量と数平 均分子量の比 (Mw/Mn) は2.6であった。次に、 このポリマー粒子を種ポリマーとして用いて、以下の重 合を行った。即ち、このポリマー粒子10部、ポリオキ シエチレンノニルフェニルエーテル 0. 1部、ラウリル 硫酸ナトリウム0.4部および過硫酸カリウム0.5部 を水900部に分散した。これにメチルメタクリレート 30部、ジビニルベンゼン50部、α-メチルスチレン 20部およびトルエン20部の混合物を加えて、70℃ で5時間重合したところ、重合収率98%でトルエンを 粒子内部に含むカプセル粒子の分散液が得られた。この 分散液に対してスチームストリップ処理を行った後、ポ リマー粒子を透過型電子顕微鏡で観察してところ、この ポリマー粒子は中央部が透けており、完全な球形の中空 ポリマー微粒子であった。この粒子の外径が0.44μ m、内径が0.3μm、比重が0.72であった。得ら れた中空ポリマー微粒子について、スプレードライ処理 を行い、中空ポリマー微粒子粉末を得た。得られた中空 ポリマー微粒子の平均粒径はO. 45μmであり、平均 粒径の-20%~+20%の範囲の粒径を有する粒子が 占める割合は、80重量%以上である。

【0042】実施例1、2

環流冷却器、撹拌機を備えた反応器に表1に示す(i) 成分、(ii)成分、(iii)成分、および(iv)成分を 加えて混合し、撹拌下、60℃で5時間反応させた。次 いで、室温まで冷却し、組成物(低誘電体形成材料)を得 た。次に、乾燥膜厚が0.2mmになるように、金型に 上記組成物を注入し、150℃で20分間加熱、乾燥し て、誘電率および誘電正接測定用テストピースを作成し た。なお、誘電率、誘電正接の測定は、JIS С 6 481に準拠し測定を行った。測定結果を表1示す。実 施例1,2は、本発明の低誘電体形成材料であり、本発 明の目的とする低誘電率の誘電体が得られている。ま た、実施例1のテストピースは実施例2のテストピース に比べ、柔軟性に優れている。

【0043】比較例1,2

表1に示す(i)、(ii)、(iii)、および(iv)の 各成分を表しに示される割合で用いる他は、実施例しと 同様にして、誘電体形成材料を調製し、テストピースを 作成し、誘電率および誘電正接を測定した。結果を表 1 に示す。比較例1、2のいずれも、実施例と比べて低誘 50 電率の誘電体が得られていない。また、比較例1は実施

14

例1に比べ、比較例2は実施例2に比べ、柔軟性に劣っ * 【0044】 ている。 * 【表1】

		実 施 例		比較例	
		1	2	1	2
	(1) 成分				
	メチルトリメトキシシラン	65	100	65	100
泵	ジメチルジメトキシシラン	35		35	
	(ii) 成分				
合	中空ポリマー微粒子	70	70		
	中空ガラス微粒子(注1)			70	70
成	(iii) 成分				
	イソプロピルアルコール	320	275	320	275
分	メチルエチルケトン	25	21	25	21
	(iv) 成分				
	シ゛-(2-アミノエチル)-アミノブ゜ロピ゜ルトリエトキシシラン	4	3.5	4	3.5
評価	誘電率	2.1	2.2	2.9	3.0
結果	誘電正接(× 1 0 · ⁵)	6	7	4	6
	柔軟性	6	0	△~×	×

(注 1)平均粒子径: 1 0 µ m

[0045]

【発明の効果】本発明の低誘電体形成材料から、集積回路が形成されたチップに電気信号を送受するための導体間に低誘電体を確実かつ容易に形成することができ、さ※

※ らに回路が形成され、積層された基板間に絶縁層を兼ね た低誘電体層を、確実かつ容易に形成することができ る。従って、集積回路を消費電力を増大させずにより小 さなパッケージに収納することが可能である。

【手続補正書】

【提出日】平成11年1月21日(1999.1.2 1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 マトリックスを形成し得る硬化性前駆体と、中空ポリマー微粒子を含有することを特徴とする低誘電体形成材料。

【請求項2】 マトリックスを形成し得る硬化性前駆体が、下記一般式(1)で示されるオルガノシラン、該オルガノシランの加水分解物、および該オルガノシランの

部分縮合物からなる群から選択される少なくとも1種を 主成分として含有することを特徴とする請求項1に記載 の低誘電体形成材料。

R¹, S i (OR²)_{4-n} 一般式(1)

(上記一般式(1) において、 R^1 は炭素数 $1\sim8$ の1 価の有機基であり、 R^2 は炭素数 $1\sim5$ のアルキル基、炭素数 $1\sim6$ のアシル基、または炭素数 $6\sim2$ 0のアリール基であり、nは $0\sim2$ の数である)

【請求項3】 中空ポリマー微粒子の平均粒径が0.03~10μmであることを特徴とする請求項1または2 に記載の低誘電体形成材料。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の低誘電体形成材料を硬化させて得られる低誘電体。

フロントページの続き

F 夕〜ム(参考) 4J002 BC012 BC032 BC052 BC072 BC072 BC092 BC093 CP091 CP091

CD07

			•
			**
•			